Express Mail Label No.: EV310329908US

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT:	SHOICHIRO MATSUMOTO	)
,	,	)
FOR:	ORGANIC EL PANEL	)

#### **CLAIM FOR PRIORITY**

Mail Stop Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

#### Dear Commissioner:

Enclosed herewith is a certified copy of Japanese Patent Application No. 2002-218862 filed on July 26, 2002. The enclosed Application is directed to the invention disclosed and claimed in the above-identified application.

Applicant hereby claims the benefit of the filing date of July 26, 2002, of the Japanese Patent Application No. 2002-218862, under provisions of 35 U.S.C. 119 and the International Convention for the protection of Industrial Property.

Respectfully submitted,

CANTOR COLBURN LLP

By:

Lisa A. Bongiovi

Registration No. 48,933

Cantor Colburn LLP

55 Griffin Road South

Bloomfield, CT 06002

Telephone:

(860) 286-2929

Customer No. 23413

Date: July 25, 2003

# Translation of Priority Certificate

#### JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

Date of Application: July 26, 2002

Application Number: Patent Application No. 2002-218862

[ST.10/C] [JP2002-218862]

Applicant(s): SANYO ELECTRIC CO., LTD.

June 26, 2003

Commissioner, Shinichiro OTA

Japan Patent Office

Priority Certificate No. 2003-3050705

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-218862

[ ST.10/C ]:

[JP2002-218862]

出 願 人 Applicant(s):

三洋電機株式会社

2003年 6月26日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



# 特2002-218862

【書類名】

特許願

【整理番号】

RSL1020056

【提出日】

平成14年 7月26日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G09C 3/20 610

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内:

【氏名】

松本 昭一郎

【特許出願人】

【識別番号】

000001889

【氏名又は名称】

三洋電機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100075258

【弁理士】

【氏名又は名称】

吉田 研二

【電話番号】

0422-21-2340

【選任した代理人】

【識別番号】

100096976

【弁理士】

【氏名又は名称】 石田 純

【電話番号】

0422-21-2340

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001753

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書

【プルーフの要否】 要

【書類名】明細書

【発明の名称】 有機ELパネル

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機EL素子を複数マトリクス状に配置した有機ELパネルであって、

各有機EL素子に対応して設けられ、対応する有機EL素子へ供給する駆動電流を制御する駆動トランジスタと、

有機EL素子が配置される表示領域の周辺に配置され、有機EL素子の駆動トランジスタを制御するための信号を出力する周辺トランジスタと、

を有し、

前記駆動トランジスタのゲート長を前記周辺トランジスタのゲート長に比べ大きくすることを特徴とする有機ELパネル。

【請求項2】 有機EL素子を複数マトリクス状に配置した有機ELパネルであって、

各有機EL素子に対応して設けられ、対応する有機EL素子へ供給する駆動電流を制御する駆動トランジスタと、

有機EL素子が配置される表示領域の周辺に配置され、有機EL素子の駆動トランジスタを制御するための信号を出力する周辺トランジスタと、

を有し、

前記駆動トランジスタのゲート長L/ゲート幅Wを前記周辺トランジスタのゲート長L/ゲート幅Wに比べ大きくすることを特徴とする有機ELパネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機EL素子を複数マトリクス状に配置した有機ELパネルに関する。

[0002]

【従来の技術】

従来より、フラットディスプレイパネルの1つとして、有機ELディスプレイ

パネルが知られている。この有機ELディスプレイパネルは、液晶ディスプレイパネル(LCD)とは異なり、自発光であり、明るく見やすいフラットディスプレイパネルとしてその普及が期待されている。

#### [0003]

この有機ELディスプレイは、有機EL素子を画素として、これを多数マトリクス状に配置して構成される。また、この有機EL素子の駆動方法としては、LCDと同様にパッシブ方式とアクティブ方式があるが、LCDと同様にアクティブマトリクス方式が好ましいとされている。すなわち、画素毎にスイッチ素子を設け、そのスイッチ素子のオンオフを制御して、各画素の表示をコントロールするアクティブマトリクス方式の方が画素毎のスイッチ素子のないパッシブ方式より高精細の画面を実現でき好ましい。

# [0004]

図4に、従来の薄膜トランジスタ(TFT)を利用した有機ELパネルにおける画素回路の構成例を示す。有機ELパネルは、このような画素をマトリクス配置して構成される。

#### $\{0005\}$

行方向に伸びるゲートラインGLには、ゲートラインGLによって選択される nチャンネル薄膜トランジスタである第1TFT10のゲートが接続されている 。この第1TFT10のドレインには列方向に伸びるデータラインDLが接続されており、そのソースには他端が容量ラインSLに接続された補助容量CSが接続されている。また、第1TFT10のソースと補助容量CSの接続点は、pチャンネル薄膜トランジスタである第2TFT21のゲートに接続されている。そして、この第2TFT21のソースが電源VLに接続され、ドレインが有機EL素子ELに接続されている。なお、有機EL素子ELの他端はカソード電源VCに接続されている。

### [0006]

そして、垂直ドライバ回路60によって、ゲートラインGLがハイレベルにセットされる。すなわち、ゲートラインGLは画素の水平ライン毎に設けられており、これが順次Hレベルにセットされる。これによって、Hレベルにセットされ

可能的 医斯克尔氏病 化二氯甲基磺基

たゲートラインGLにゲートが接続されている第1TFT10がすべてオンする

#### [0007]

一方、データラインDLは、水平ドライバ回路62が接続されており、この水平ドライバ62は表示すべきビデオ信号(データ)がビデオ信号ラインに供給されるタイミングで、ビデオ信号ラインとデータラインDLを接続する。

#### [000.8]

従って、ゲートラインGLがHレベルの時に第1TFT10がオンとなり、そのときのデータラインDLのデータが補助容量CSに保持される。そして、この補助容量CSに維持されているデータ(電位)に応じて第2TFT21がオンされ、第2TFT21がオンしている場合に有機EL素子ELに電流が流れ、発光する。

#### [0009]

また、図5に示すように、ゲートラインGLを制御する垂直ドライバ回路60 およびデータラインDLを制御する水平ドライバ回路62は、有機EL素子がマトリクス配置される表示領域の周辺に配置されている。なお、有機ELパネルで必要な電源、各種信号などは表示領域の周辺に配置されたインタフェース64を介し供給される。

# ..[0010]

ここで、第2TFT21は、容量に保持された電圧に応じた電流を広範囲に安 定して流すことが要求される。また、電流量をなるべく抑え、低消費電力を実現 したいという要求がある。

#### [0011]

このため、この第2TFT21についての電源電圧を低く設定することが考えられる。これによって、第2TFTに流す電流を小さくでき、かつ電流量の調整の範囲を維持することができる。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、第2TFT21の電源電圧を低くすると、有機EL素子のバラツキや

第2TFT21のバラツキに基づいて発光量制御がうまくいかなくなるという問題もあった。

#### [0013]

本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、第2TFTの動作を十分なものに維持することができる有機ELパネルを提供することを目的とする。

# [0014]

#### 【課題を解決するための手段】

本発明は、有機EL素子を複数マトリクス状に配置した有機ELパネルであって、各有機EL素子に対応して設けられ、対応する有機EL素子へ供給する駆動電流を制御する駆動トランジスタと、有機EL素子が配置される表示領域の周辺に配置され、有機EL素子の駆動トランジスタを制御するための信号を出力する周辺トランジスタと、を有し、前記駆動トランジスタのゲート長を前記周辺トランジスタのゲート長に比べ大きくすることを特徴とする。

# [0015]

このように、本発明によれば、駆動トランジスタのゲート長が大きく設定されている。そこで、駆動トランジスタから有機EL素子に供給する電流量を小さくすることができ、かつ広範囲で確実な電流量制御が行える。

#### [0016]

また、有機EL素子を複数マトリクス状に配置した有機ELパネルであって、各有機EL素子に対応して設けられ、対応する有機EL素子へ供給する駆動電流を制御する駆動トランジスタと、有機EL素子が配置される表示領域の周辺に配置され、有機EL素子の駆動トランジスタを制御するための信号を出力する周辺トランジスタと、を有し、前記駆動トランジスタのゲート長L/ゲート幅Wを前記周辺トランジスタのゲート長L/ゲート幅Wに比べ大きくすることを特徴とする。

#### [0017]

これによっても、駆動トランジスタのゲート長が大きく設定されている。そこで、電流量を小さくすることができ、かつ広範囲で確実な電流量制御が行える。

#### [0018]

# 【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。図1は、本実施 形態に係る回路における画素部分の概略構成を示す平面図である。なお、この回 路構成は、上述の図4と同一である。

#### [0019]

列(垂直)方向にはデータラインDLおよび電源ラインVLが所定間隔で配置され、行(水平)方向にはゲートラインGLが所定間隔で配置され、これらデータラインDLと、ゲートラインGL、電源ラインVLで区画された画素エリアに第1、第2TFT(駆動トランジスタ)10、21、容量CS、有機EL素子50が設けられている。

#### [0020]

データラインDLは、例えば、アルミから構成され、これに第1TFT10のドレインがコンタクト12によって接続されている。ここで、データラインDLの画素領域の右上に当たる部分には内側に向けて突出する突出部12aが設けられており、ここにコンタクト12が形成されている。

# [0021]

第1TFT10は、ガラス基板上に設けられたポリシリコンからなる半導体層14を有しており、データラインDLの突出部12aの下方に半導体層14の一端が延びここが厚み方向に延びるコンタクト12によって突出部12aに接続されている。

#### [0022]

第1TFT10は、このコンタクト12がドレイン領域になっている。そして、この半導体層14は、水平方向に延び、その上方にはゲート絶縁膜を介し、2つのゲート電極16が配置されている。このゲート電極16は例えばMo、Crなどで形成されるゲートラインGLから下方(内側)に向けて突出形成されている。半導体層14は、ゲート電極16の下方の半導体層14がチャネル領域になっており、ドレイン領域と反対側の端部がソース領域になっている。

#### [0023]

半導体層14はそのまま延び容量CSの一方側の電極となっている。この容量

CSは、半導体層14と、これに誘電体層を介し対向する容量電極からなっており、この容量電極は容量ラインSLの一部として形成されている。容量ラインも例えばMo、Crなどで形成される。

## [0024]

ポリシリコンからなる半導体層14は、容量CSの電極の部分からそのまま下方に延びアルミで接続された一対のコンタクト18a、18bを介し第2TFT21のゲート電極20に接続される。なお、ゲート電極20は、例えばMoで形成される。ここで、第2TFT21は、半導体層22を有しており、この半導体層22の両端部が電源ラインVLに接続されるドレイン領域、中央部が有機EL素子50に接続されるソース領域、ドレイン領域とソース領域の間であってその上方にゲート絶縁膜を介しゲート電極20が配置される部分がチャネル領域になっている。

#### [0025]

また、第2TFT21を構成する半導体層22は、電源ラインVLに沿って延びる細長い形状をしている。そして、その上下端の一対のドレイン領域の厚み方向の上方に電源ラインVLの一部が突出して一対の突出部24a、24bが形成され、ここにコンタクト26a、26bがそれぞれ形成されて電源ラインVLと第2TFT21の一対のドレイン領域との接続が行われる。

#### [0026]

ここで、本実施形態においては、図2に模式的に示すように、第2TFT21のゲート長しは、周辺ドライバ回路に用いる周辺TFT(周辺トランジスタ)に比べ長くしている。ここで、この周辺TFTとしては、ゲートラインGLや、データラインDLの選択を制御するための垂直ドライバ回路や水平ドライバ回路のシフトレジスタを構成するTFTが挙げられる。なお、周辺ドライバ回路には、各種のTFTが利用されるが、これらは基本的にすべて同一のプロセスで形成され、そのサイズも基本的には同一である。

# [0027]

周辺TFTは、スイッチング動作を行うものであり、第2TFTとは異なる電源(Vdd)により高速動作する。従って、そのゲート長Lは、小さいものが好

適である。

[0028]

一方、第2TFT21は、そのゲート電圧の制御により、有機EL素子51への電流量を制御して表示輝度の制御を行うものである。従って、所定の範囲の電流量を正確に制御できる必要がある。本実施形態の第2TFT21では、ゲート長しが長くなっている。そこで、低電流領域においても、ゲート電圧による電流量制御を確実に行えるという効果が得られる。このようにゲート長しを大きくすると、TFTの動作が遅くなる。しかし、第2TFTは、補助容量CSに保持される電圧によって、通常1フレームの期間同一の電流を流し続ける。従って、スイッチのオンオフ動作が高速である必要がなく、ゲート長しを大きくすることで、好適な特性を得ることができる。

[0029]

なお、図2において第2TFT21は、並列接続される2つのトランジスタの内、1つのトランジスタのみを示している。

[0030]

ここで、第2TFT21のゲート長Lを設定する場合、次の条件を満足する必要がある。

[0031]

(i)画素の第2TFTに流れる電流 Idsは、周辺TFTに比べ微小な電流であり、有機材料に応じたオン電流(Ion:白表示)と、オフ電流(Ioff: 黒表示)が存在し、適切な階調表示の場合、Ion/Ioff  $\ge 100$  を満足する必要がある。

[0032]

(ii) そして、このような広範囲の電流制御を現在開発されている有機材料で形成される有機EL素子を駆動する第2TFT21において実現するには、バラツキや劣化特性を考慮し、電源ラインVLの電圧として所定の最低電源電圧PVddminと、最短ゲート長Lminが必要である。また、オン電流Ionを流せる最大電源電圧PVddmaxと最長ゲート長Lmaxも存在する。

[0033]

上述のような条件を満足するためには、図3に斜線で示すように、第2TFT 21を有効な動作範囲内で動作させるために、適切なゲート長Lの許容範囲が存在する。そして、このゲート長Lは、周辺トランジスタにおいて適切なゲート長と比べ必ず長くなる。従って、本実施形態に係る第2TFT21により、好適な階調制御が行え、かつ周辺トランジスタにおいて、十分な高速動作を維持することができる。また、周辺トランジスタは、電源をVddとし、ゲート電圧で決まる最大駆動電流Idsmaxで動作する。

#### [0034]

さらに、周辺トランジスタにおいて、十分な電流を得、また第2駆動TFT2 1においてIonを確保するためには、ゲート幅Wとしてほぼ同一のものが必要であり、第2TFT21のゲート長L/ゲート幅Wを周辺回路におけるTFTのゲート長L/ゲート幅Wに比べ大きくすることが必要になる。

# [0035]

なお、周辺トランジスタのゲート幅W/ゲート長Lは $5\sim500\mu$ m/ $1\sim10\mu$ m, 第2駆動TFTのゲート幅W/ゲート長Lは $5\sim10\mu$ m/ $10\sim100\mu$ m程度が好ましい。

[0036]

#### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、駆動トランジスタのゲート長を大きくまたはゲート幅/ゲート長比を小さく設定する。そこで、電流量を小さくすることができ、かつ広範囲で確実な電流量制御が行える。

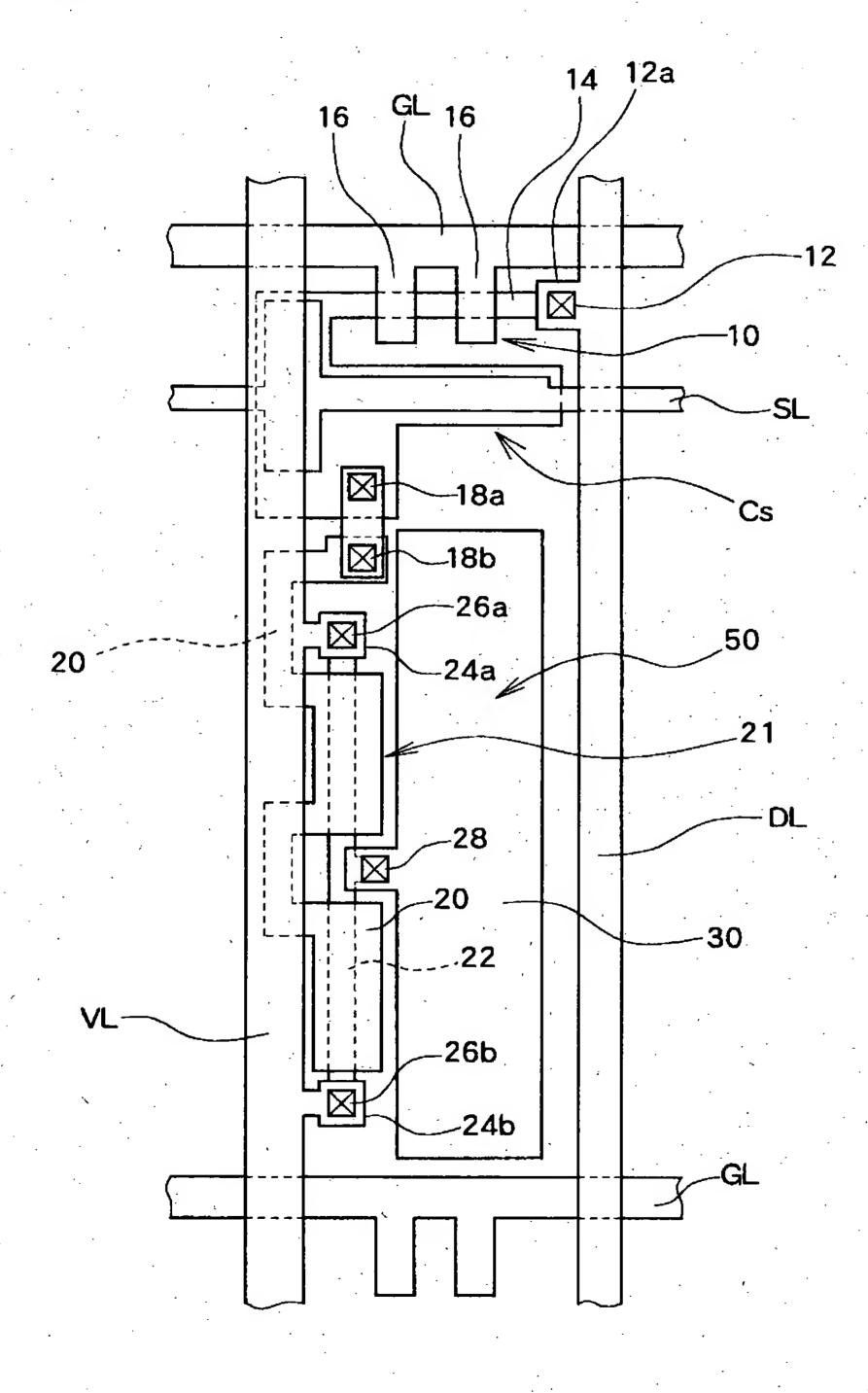
#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】 実施形態に係る第2TFTを含む画素の構成を示す図である。
- 【図2】 第2TFTと周辺TFTの構成を示す図である。
- 【図3】 適切なゲート長の示す図である。
- 【図4】 画素回路の構成を示す図である。
- 【図5】 有機ELパネルの全体構成を示す図である。

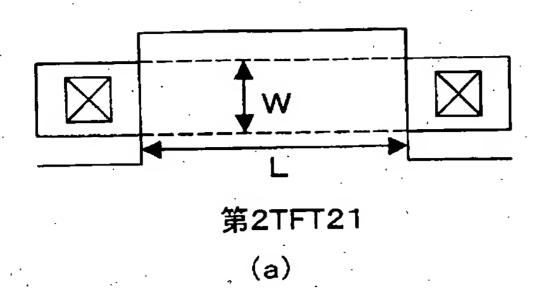
#### 【符号の説明】

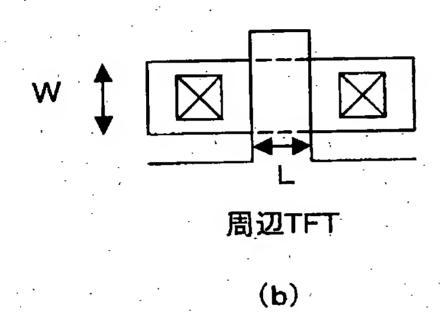
21 第2TFT、60 垂直ドライバ回路、62 水平ドライバ回路。

【書類名】図面【図1】

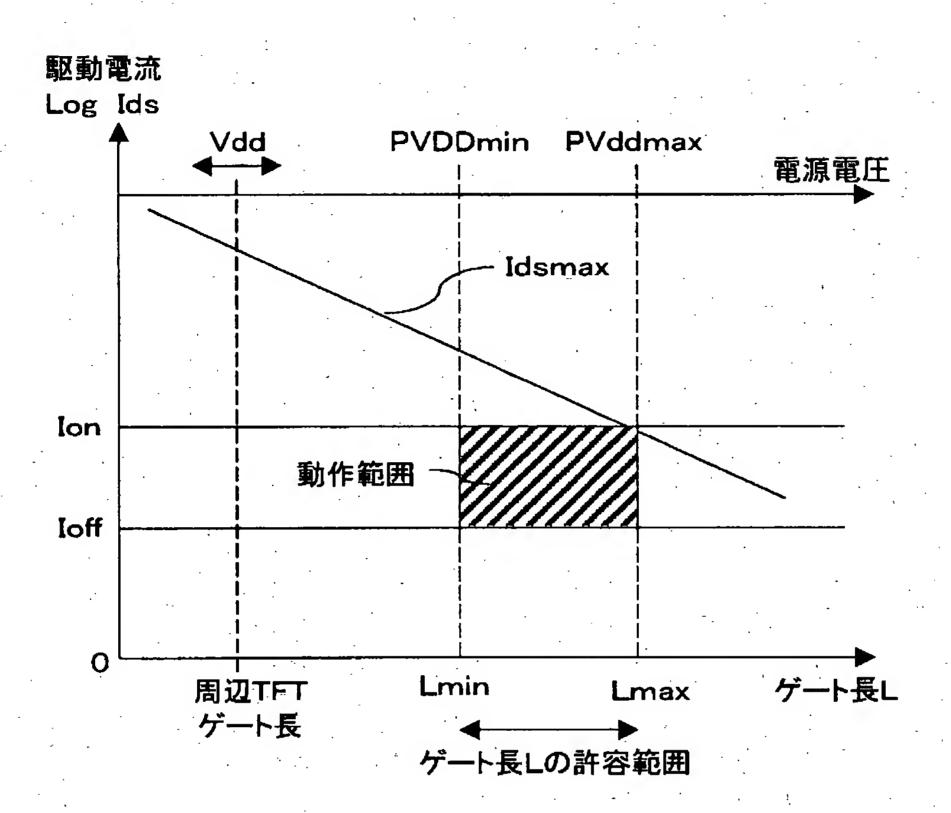


# 【図2】

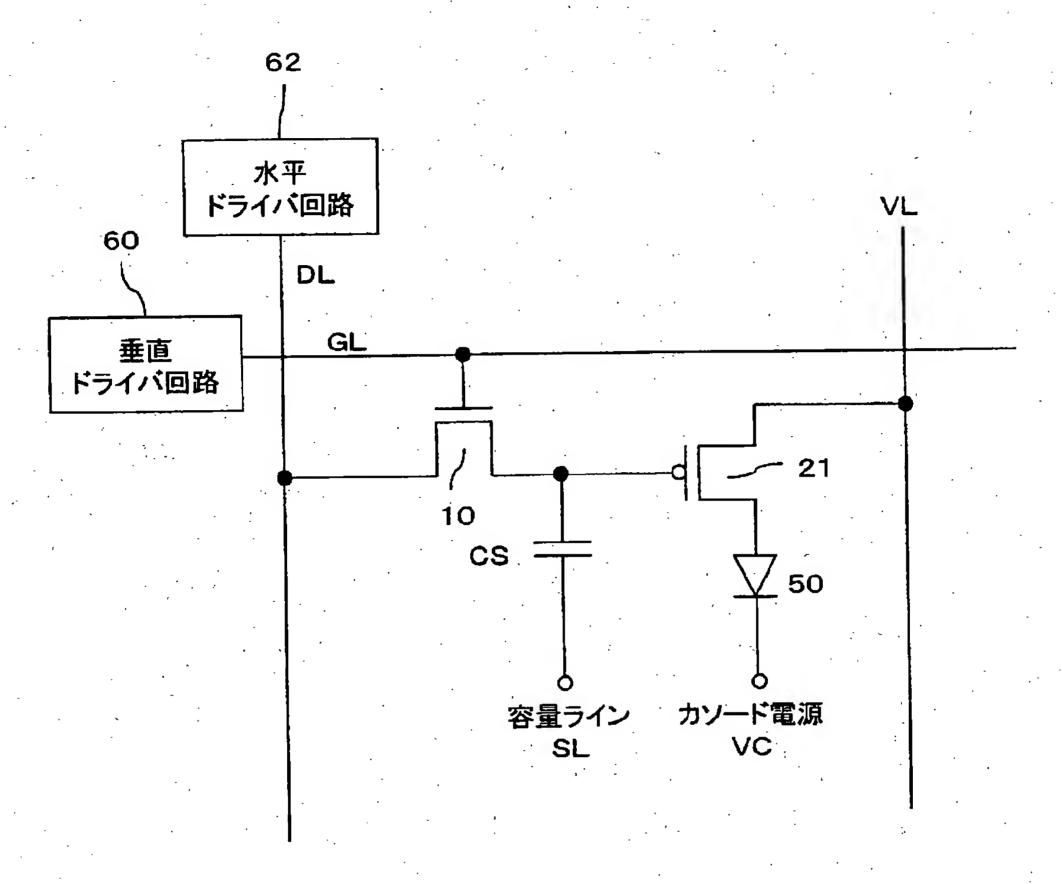




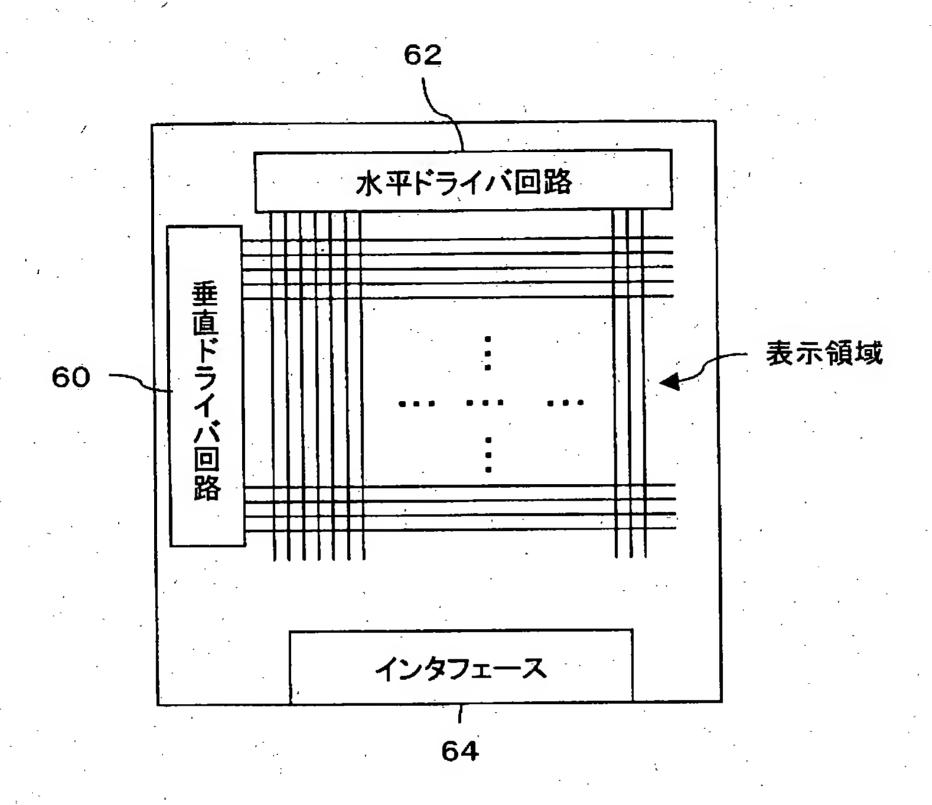
【図3】



# 【図4】



【図5】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 第2TFTによるEL素子駆動電流制御を効果的に行う。

【解決手段】 第2TFT21のゲート長Lを周辺TFTのゲート長Lに比べ大きくする。これによって、第2TFT21により小さな電流まで精度よく制御することができる。

【選択図】

図 2

# 出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日 1993年10月20日

[変更理由] 住所変更

住 所 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

氏 名 三洋電機株式会社